This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

MENU SEARCH

INDEX

DETAIL

BACK

NEXT

8/11



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 07176534

(43)Date of publication of application: 14.07.1995

(51)Int.CI.

H01L 21/321

(21)Application number: 05317587

(71)Applicant:

NEC CORP

(22)Date of filing: 17.12.1993

(72)Inventor:

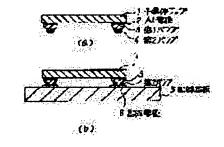
TANAKA TAKASHI

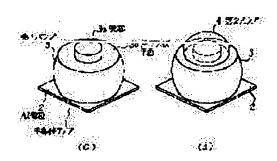
(54) BUMP AND MANUFACTURING METHOD AND DEVICE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a reliable connection of a semiconductor chip to a wiring board in an easily replaceable manner.

CONSTITUTION: A first bump 3 possessed of a projection at its upper center is fixed to an Al electrode 2 of a semiconductor chip 1, and a second bump 4 which is formed of metal particle-containing resin or solder and smaller than the first bump 3 in diameter is put on the top of the first bump 3. When the Al electrode 2 is connected to the board electrode 6 provided onto a wiring board 5, the second bump 4 is deformed and heated, if necessary. By this setup, as the second bump 4 is smaller than the first bump 3 in diameter, a narrow pitch connection can be carried out without causing a connection failure such as a short circuit which occurs between adjacent circuits.





THIS PAGE BLANK (USPTO)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 12.08.1994

[Date of sending the examiner's decision of 01.04.1997

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]2687856[Date of registration]22.08.1997

[Number of appeal against examiner's decision 0906698

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 25.04.1997

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

MENU SEARCH INDEX DETAIL BACK NEXT

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-176534

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

(51)IntCl. ⁶ H 0 1 L 21/3	識別記号 321	庁内整理番号	FI			技術表示箇所		
			H01L	21/ 92		F C D		
			審査請求	で 有 請求	項の数9	OL	(全 6	頁)
(21)出願番号	特願平 5-317587		(71)出願人	000004237	004237 \$電気株式会社			
(22)出願日	平成 5 年 (1993) 12月17日 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 (72) 発明者 田中 敬 東京都港区芝五丁目 7 番 1 号 日本電気株							3.株
			(74)代理人	式会社内 弁理士 京本	直掛 (外2名)		

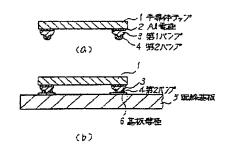
(54) 【発明の名称】 バンプ並びにその製造方法及び製造装置

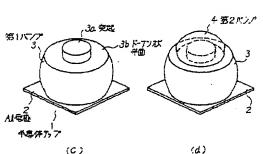
(5 【要約】

【目的】半導体チップをバンプを用いて信頼性の高い、 かつ交換の容易な配線基への接続を行う。

【輝成】半導体チップ1のAI電極2に、上面の中央部 に第1バンプ3よりも径の小さい金属粒子を含む樹脂材 料またははんだによりなる第2バンプ4を被せる。配線 基板5上の基板電極6への接続は第2バンプ4を変形さ せ、必要により加熱する。

【効果】第2パンプは第1バンプよりも径が小さいた め、狭ピッチの接続においても隣接する配線とのショー トなどの接続不良の発生を防げる。





(C)

【特許請求の範囲】

基板の電極上に底面が固定されたほぼ円 【請求項1】 筒形状で上面の中央部に突起を有する導電性材料からな る第1バンプと、この第1バンプ上に前記突起を覆うよ うに形成され外径が前記第1バンプの外径よりも小さい 導電性材料からなる第2バンプとを含むことを特徴とす るバンプ。

【請求項2】 第2バンプの外径は第1バンプの外径の 40~80%である請求項1記載のバンプ。

【請求項3】 第2バンプが導電樹脂材料からなる請求 項1又は2記載のバンプ。

【請求項4】 第2バンプがはんだからなる請求項1又 は2記載のバンプ。

【請求項5】 基板は半導体テップである請求項1, 2, 3又は4記載のバンプ。

基板に設けられた電極に底面が固着され 【請求項6】 ほぼ円筒形状で上面の中央部に突起を有する第1の導電 性材料からなる第1バンプ上に前記突起を覆うように外 径が前記第1バンプの外径より小さい第2の導電性材料

液状の前記第2の導電性材料の液面に接して前記基板上 の前記第1バンプに対応して外径が前記第1バンプの外 径より小さい開口部を配置したマスクを置き、前記突起 を前記開口部に挿入させて前記第1バンプを前記マスク に押し当てから前記第1バンプが前記第2の導電性材料 の液面から離れるように前記基板を引き上げて前記第1 バンプの先端部に前記第2の導電性材料を付着させて前 記第2バンプを形成することを特徴とするバンプの製造 方法。

【請求項7】 基板に設けられた電極に底面が固着され ほぼ円筒形状で上面の中央部に突起を有する第1の導電 性材料からなる第1バンプ上に前記突起を覆うように外 径が前記第1バンプの外径より小さい第2の導電性材料 からなる第2バンプを形成するバンプの製造方法におい

前記基板上の前記第1バンプに対応して外径が前記第1 バンプの外径より小さい開口部が配置され水平に置かれ たマスクの下側に満たされた液状の前記第2の導電性材 料を加圧して前記開口部に前記第2の導電性材料の隆起 を形成し、この隆起に前記第1バンプの前記突起を沈み こませてから前記第1バンプが前記隆起から離れるよう 前記基板を引き上げて前記第1バンプの先端部に前記第 2の導電性材料を付着させて前記第2バンプを形成する ことを特徴とするバンプの製造方法。

【請求項8】 基板に設けられた電極に底面が固着され ほぼ円筒形状で上面の中央部に突起を有する第1の導電 性材料からなる第1バンプ上に前記突起を覆うように外 径が前記第1バンプの外径より小さい第2の導電性材料 から第2バンプを形成するためのバンプの製造装置にお WT.

液状の前記第2の導電性材料を収容する材料槽と、この 材料槽の上面を覆い前記基板上の前記第1バンプに対応 して開口部が配置された水平なマスクと、前記第2の導 電性材料を貯蔵するシリンジと、前記シリンジから前記 材料槽への前記第2の導電性材料の供給及び前記材料槽 内の前記第2の導電性材料の加圧を制御するディスペン サとを含むことを特徴とするバンプの製造装置。

第2の導電性材料ははんだで材料槽内の 【請求項9】 はんだを加熱するヒーターを備えた請求項8記載のバン プの製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体チップ等の電子 部品を配置基板と電気的に接続するために半導体基板な どに設けられる電極上に形成されるバンプ及びその製造 方法及び製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の半導体チップのバンプを図7に示 からなる第2バンプを形成するバンプの製造方法におい、 $2(-t_c)$ の $2(-t_c)$ の $2(-t_c)$ はバンプ3上に設ける導電性樹 脂材料の形成方法を示し、図7(d)は配線基板上にバ ンプを用いて搭載した半導体チップを示す。

> 【0003】図7 (a) に示すように半導体チップ1の A 1 電極 1 上にバンプ3'が設けられている。平坦なガ ラス基板21上に厚さ20~30μmの導電性樹脂膜7 を形成し、その膜7に上から半導体チップ1のバンプ 3'を押し当てる(図7(b))。その後半導体チップ 1を上昇させてバンプ3'を導電性樹脂膜から離すとバ ンプ3、上に導電性樹脂材料22が付着する(図7

(c))。この付着した樹脂材22は、バンプ3'の径 と同じ、もしくはより大きい径で付着し、さらに半導体 チップ1をガラス基板21上の膜7に押し付けたときに バンプ3′の周囲の導電性樹脂膜7に盛り上がり23が 生じ、盛り上がり方によってバンプ3, へ付着する導電 性樹脂材料22の量がばらつく。

【0004】図7 (d) に示すように半導体チップ1を 配線基板上5に搭載するとバンプ3′上の付着樹脂材料 22は配線基板5上に広がり、半導体チップ1と配線基 板5との機械的、電気的接続を行う。

【0005】また導電性樹脂材料をバンプ上に形成する 従来の第2の方法は「特開平1-143291」の様な 方法がある。この方法は図8に示すようにメタルマスク 10の開口部9に導電性樹脂材料7をあらかじめ充填し ておき、この開口部9を半導体チップ1のバンプ3'に 位置合わせした後に、導入口24からの高圧空気の噴出 により導電性樹脂材料7をバンプ3'上に付着させる方 法である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】図7に示した従来の半 50 導体チップのバンプは、半導体チップ1のA1電極2上

のバンプ3′に付着する導電性樹脂材料22の径は、バ ンプ3'の径に対してほぼ同じかもしくは大きくなって いる。これはバンプ37を直接導電樹脂材料膜7に浸し てしまうことにより大きくなる。この半導体チップ1を 基板電極6へ接続すると、導電樹脂材料22はさらに広 がり、電極6が狭ピッチで設けられていると導電性樹脂 22により隣接する電極がショートしやすくなるといっ た問題点があった。また半導体チップ1の不良により半 導体チップ1を交換する場合に、導電樹脂材料22の付 着している面積が広いため、半導体チップΙを配線基板 5から剥離した際に、基板電極6と半導体チップ1の両 方へのダメージが大きくなるといった問題点があった. 図8に示した従来の方法では、付着する導電性樹脂材料 がバンプ3'の側面に回り込み、パンプ3'の上部に安 定して形成することが難しいといった問題点があった。 [0007]

【課題を解決するための手段】本発明のバンプは、基板の電極上に底面が固定されたほぼ円筒形状で上面の中央部に突起を有する導電性材料からなる第1バンプと、この第1バンプ上に前記突起を覆うように形成され外径が前記第1バンプの外径よりも小さい導電性材料からなる第2バンプとを備えている。

【0008】本発明は、基板に設けられた電極に底面が固着されほぼ円筒形状で上面の中央部に突起を有する第1の導電性材料からなる第1バンプ上に前記突起を覆うように外径が前記第1バンプの外径より小さい第2の導電性材料からなる第2バンプを形成するバンプの製造方法において、液状の前記第2の導電性材料の液面に接して前記基板上の前記第1バンプに対応して外径が前記第1バンプの外径より小さい開口部を配置したマスクを置き、前記突起を前記開口部に挿入させて前記第1バンプを前記マスクに押し当てから前記第1バンプが前記第2の導電性材料の液面から離れるように前記基板を引き上げて前記第1バンプの先端部に前記第2の導電性材料を付着させて前記第2バンプを形成することを特徴とする。

【0009】本発明は基板に設けられた電極に底面が固着されほぼ円筒形状で上面の中央部に突起を有する第1の導電性材料からなる第1バンプ上に前記突起を覆うように外径が前記第1バンプの外径より小さい第2の導電性材料からなる第2バンプを形成するバンプの製造方法において、前記基板上の前記第1バンプに対応して外径が前記第1バンプの外径より小さい開口部が配置され水平に置かれたマスクの下側に満たされた液状の前記第2の導電性材料を加圧して前記開口部に前記第2の導電性材料の隆起を形成し、この隆起に前記第1バンプの前記突起をよみこませてから前記第1バンプが前記隆起から離れるよう前記基板を引き上げて前記第1バンプの先端部に前記第2の導電性材料を付着させて前記第2バンプを形成することを特徴とする。

【0010】本発明は基板に設けられた電極に底面が固着されほぼ円筒形状で上面の中央部に突起を有する第1の導電性材料からなる第1バンプ上に前記突起を覆うように外径が前記第1バンプの外径より小さい第2の導電性材料から第2バンプを形成するためのバンプの製造装置において、液状の前記第2の導電性材料を収容する材料槽と、この材料槽の上面を覆い前記基板上の前記第1バンプに対応して開口部が配置された水平なマスクと、前記第2の導電性材料を貯蔵するシリンジと、前記シリンジから前記材料槽への前記第2の導電性材料の供給及び前記材料槽内の前記第2の導電性材料の供給及び前記材料槽内の前記第2の導電性材料の供給及び前記材料槽内の前記第2の導電性材料の供給及び前記材料槽内の前記第2の導電性材料の加圧を制御するディスペンサとを備えている。

[0011]

【実施例】次に、本発明について図面を参照して説明す ろ

【0012】図1(a)は本発明の一実施例のバンプを示す断面図である。

【0013】半導体チップ1のA1電極2へAu、Cu、Pd、Ni等の金属で構成される直径が50~80μm、突起を含まない部分の高さが30~50μmの上部に突起を有する第1バンプ3が形成されており、第1バンプ3上に導電性樹脂材料またははんだよりなる第2バンプ4が形成されている。第1バンプ3の形状は図1(c)に示すように、突起を除く部分がほぼ円筒上になっており、その上面の中央部に突起3aを有している。突起3aの回りは環状の平面3bとなっている。突起3aの直径は20~40μm、高さは10~30μmの範囲である。

【0014】第2バンプ4は図1 (d) に示すように第 1バンプ3のドーナツ上の平面3bの上に形成され、第 1バンプ3の突起3aを覆い隠すように形成されてい る。第2バンプ4は第1バンプ3よりも体積が小さく、 かつ第2バンプ4の直径は第1バンプ3の径の40~80%の大きさになっている。

【0015】図1 (b) は半導体チップ1を配線基板 5 上に搭載したものの断面図であり、バンプの枝葉形態を 示すものである。半導体チップ1はガラスエポキシやセ ラミックの配線基板5に位置合わせして搭載され、バン プを介して配線基板5との接続を行う。第2バンプ4は 基板電極6へ押し付けられ変形している。この第2バン プ4の変形により、第1パンプ3の高さのばらつきや配 線基板5の反りにより発生する半導体チップ1と配線基 板5との間隙量のばらつきを吸収し、半導体チップ1上 の前記バンプと基板電極6との接続を可能にしている。 第2バンプ4は高さ方向が圧縮されてつぶれるように変 形するため、配線基板5接続後の第1バンプ4の径は接 統前よりも大きくなっている。しかし、第2バンプ4の 径は第1バンプ3の径よりも小さく形成しているため、 変形後の第2パンプ4のけいも第1パンプ3の径程度の SC 大きさであり、隣接するAl電極2、配線電極6とのシ

ョートは発生しない。

【0016】第2バンプ4が導電樹脂材料からなる場合は、基板電極6との接続後、第2バンプ4を加熱硬化させ電気的接続をとる。ここで使用する導電性樹脂材料は例えば住友ベークライト社製の1085Xのようなエキボシ樹脂を基材とし、Ag粉、AgPd合金粉、PdメッキAg粉、PdメッキNi粉などの金属粒子を分散させたものである。また、導電性樹脂材料の変わりに、はんだを用いることも可能である。はんだは、SnPb、SnPbAg、SnAg、PbIn等がある。はんだの場合は配線基板5との接続時に、配線基板5を加熱しはんだを溶融させて接続させる。

【0017】図2は第1バンプ3上に第2バンプ4を形成する製造装置を示す断面図であり、図3 (a)~

(c) は製造工程の流れを表す図である。ここでは第2 パンプを導電性樹脂材料を使用した場合について述べる。

【0018】第2バンプ4の材料である、導電性樹脂材料25は液体で樹脂材料槽8内に満たされており、その液面高さには、半導体チップ1の第1バンプ3と同位置に配置されかつ第1バンプ3の直径よりも小さいが突起3dを通すことのできる円形の開口部9を有するメタルマスク10が固定されている。樹脂材料槽8の下部には、導電性樹脂材料25の補充を行う補充口11が設けられており、補充口11にはシリンジ12が接続されており、シリンジ12内には補充用の導電性樹脂材料25が収納されている。導電性樹脂材料25の補充はディスペンサ13にてコントロールする。

【0019】次に製造工程を順を追って説明する。第1 バンプの製造工程は、従来技術と同じく銅等のワイヤに よるボールボンディング技術により形成されるのでここ では説明を省略する。

【0020】図3(a)のようにA1電極2の位置を開口部9に合わせた状態から半導体チップ1を下降させメタルますク10の開口部9へ第1バンプ3を押し当て、第1バンプ3の突起3(a)を開口部9に挿入する(図3(b))。その後半導体チップ1を上昇させると第1バンプ3の先端に導電性樹脂材料25による第2バンプ4が形成される(図3(c))。第2バンプ4に使用された分の導電性樹脂材料25はディスペンサ13の制御により補充され樹脂材料槽は図3(a)のもとの状態に戻る。

【0021】導電性樹脂材料25の替わりにはんだを使用する場合は、図2と同様に開口部9を有するメタルマスクを設けたはんだ槽に入れたはんだをヒーターで溶融させて、図3に示すのと同様は方法で第2バンプの形成を行う。

【0022】第1バンプ3上に第2バンプ4を形成する。 他の方法を図4に示す。図2に示す製造装置において、 ディスペンサ13によりシリンジ12および樹脂材料槽 8内の導電性樹脂材料2.5を加圧し、メタルマスク10の開口部9へ導電性樹脂材料2.5の隆起1.5を形成する(図4(a))。A1電極2の位置を開口部9に合わせて半導体チップ1を下降させ樹脂材料隆起1.5へ第1バンプ3を押し当て、第1バンプ3の先端の突起3.aを樹脂材料隆起1.5に沈み込ませる(図4(b))。その後半導体チップ1を上昇させると第1バンプ3の先端に導電性樹脂材料7によるバンプ4が形成される(図4

(c))。第2バンプ4に使用された分、樹脂材料隆起 15は低くなるが、ディスペンサ13により加圧し樹脂 材料隆起15は図4(a)に示す元の状態に戻る。この 方法においても導電性樹脂材料25のかわりにはんだを 使用することができる。本発明の半導体装置は、半導体 チップ1のA1電極2上の第1バンプ3に形成される第2バンプ4は、第1パンプ3の直径に対して40~80%の大きさにしているため、半導体チップ1を基板電極へ接続したときに第2バンプ4が変形しても第2バンプ4は、第1バンプ3もしくはA1電極2の接続ピッチと 比較して小さいため、隣接する電極とのショートが発生 しないため狭ピッチ接続に適しているといったメリット を有する。

【0023】具体的なデータを以下に示す。図5は本発明による半導体チップ1の第2バンプ4の径と剥離強度およびショートの発生率の関係を表したものである。図6(a)~(c)は第2バンプ4が種々の大きさの場合の第1バンプ3と第2バンプ4の径が第1バンプ3の径の90%である場合で、この場合は図5に示す通り、1バンプ当たりの剥離強度は十分であるが、隣接する電極とのショートが発生することがある。

【0024】図6(b)は、第2バンプ4の径が第1バンプ3の径の50%である場合で、この場合は図5によれば剥離強度は図6(a)の場合に比べてやや小さいが実用には十分な値を得ており、隣接する電極とのショートも発生しない。図6(c)は、第2バンプ4の径が第1バンプ3の径の30%である場合で、この場合は図5によれば隣接する電極とのショーは発生していないが剥離強度は不足している以上により第2バンプ4の径は第1バンプの径の40 \sim 80%が適正な範囲である。

4 [0025]

[発明の効果]以上説明したように本発明は、基板の隣接する電極とショートが発生しないため狭ビッチの電極を用いた接続に適している。

【0026】また半導体チップ等の不良により半導体チップなどを交換する場合に、変形した第2バンプの付着している面積が狭いため、半導体チップ等を剥離した際の基板電極と半導体チップ等へのダメージが小さく、かつ、半導体チップ等の剥離後の配線基板上の第2バンプの残量が少なく、除去作業が容易になるといった効果を 54 有する。 7

【0027】また本発明のバンプの製造方法により、一定体積の第2バンプが安定にかつ容易に形成できるという効果を有する。

【0028】また本発明のバンプの製造装置では第2の 導電性材料がメタルマスクの開口部以外は空気に触れて いないため、第2の導電性材料が導電樹脂材料の場合に 溶剤が揮発しにくく、粘度等の特性が変化しにくいとい う硬化を有する。

【0029】またメタルマスクの開口部を介して第2バンプを形成するため、半導体チップの他の部分に第2バンプ材料が付着するという不良が発生しないという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a) は本発明のバンプの一実施例を示す断面図であり、(b) は(a) に示す実施例を配線基板と接続した状態を示す断面図である。(c) は(a) に示す実施例の一部の第1バンプ3の拡大斜視図、(b) は(a) に示す実施例の拡大斜視図である。

【図 2】本発明のバンプの製造方装置の一実施例を示す 構成図である。

【図3】本発明のバンプの製造方法の一実施例の工程の 流れを表す図である。

【図4】本発明のバンプの製造方法の他の実施例の工程 の流れを表す図である。

【図5】図1に示す実施例の第2バンプの径と接続特性の関係について表した図である。

【図6】図1に示す実施例の第1バンプと種々の大きさにした第2バンプの平面拡大図である。

【図7】(a)~(c)は従来のバンプの製造方法を工程順に表す図である。(d)は配線基板5の基板電極に接続した従来のバンプを示す断面図である。

【図8】従来の他のバンプの製造方法を示す図である。 「~~号の説明]

半導体チップ

AI電極

第1バンプ

3; 突起

C ? ・ ドーナッ上平面

微小第2バンプ

配線基板

基板電極

導電性樹脂材料

樹脂材料槽

! 開口部

1(メタルマスク

1 補充口

1: ・シリンジ

1 ディスペンサ

1 ヒーター

1: 樹脂材料隆起

2: ガラス基板

2! 付着樹脂材料

2: 樹脂材料盛り上がり

2: 高圧空気導入口

2 : 導電性樹脂材料

[図2]

[図3]

